Searching PAJ 페이지 1 / 2

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 08-269185 (43)Date of publication of application: 15.10.1996

(51)Int.Cl. **C08G 64/30** 

(21)Application number: **08–011396** (71)Applicant: **IDEMITSU KOSAN CO LTD** 

(22)Date of filing: 26.01.1996 (72)Inventor: KUZE SHIGEKI

TANAKA KENJI SUGA KOICHI

(30)Priority

Priority number: **07 14483** Priority date: **31.01.1995** Priority country: **JP** 

#### (54) **PRODUCTION OF POLYCARBONATE**

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To efficiently obtain a polycarbonate excellent in color, heat resistance, hydrolysis resistance, etc., having a high quality at a high reaction rate, and facilitating the removal of a polymerization catalyst at the final reaction stage by performing transesterification in the presence of the specific polymerization catalyst. CONSTITUTION: Transesterification is performed in the presence of the combination of (A) a nitrogen-containing organic basic compound such as a compound of formula: (NR14)+(X1)- [R1 is an organic group, and two groups of F1 may be combined with each other to form a ring; X1 is a halogen, OH, an alkyl(carbonyl)oxy, an aryl(carbonyl) oxy, etc.,] or a compound of formula: (NR14)+2CO32with (B) a quaternary phosphonium salt such as a compound of formula: (PR24)+(X2)- (R2 is R1; R2 is a halogen, OH, an alkyloxy, etc.,) [e.g. a compound of formula I (R3 is R1; X3 is X1; n is (0-4)] or a compound of formula: (PR24)+2CO32- (e.g. a compound of formula II) as a catalyst to obtain the objective polymer.

$$((R^* \longrightarrow_{n} P \longleftrightarrow)_{a=n})^* (X^*)^-$$

 $((R^* \longrightarrow_{\overline{n}} P (\bigcirc))_{1-\overline{n}})^*_{2} (Y^*)^{**}$ 

11

ľ

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination] 03.03.2000 [Date of sending the examiner's decision of 11.12.2001

reiection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3354777
[Date of registration] 27.09.2002
[Number of appeal against examiner's decision 2002–000310

Searching PAJ 페이지 2 / 2

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's 10.01.2002 decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) **公** 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-269185

(43)公開日 平成8年(1996)10月15日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup> 識別記号 庁内整理番号 F I 技術表示箇所

C 0 8 G 64/30 N P U C 0 8 G 64/30 N P U

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 15 頁)

出光興產株式会社

(21)出願番号 特願平8-11396 (71)出願人 000183646

(22)出願日 平成8年(1996)1月26日 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

 (31)優先権主張番号 特願平7-14483
 (72)発明者 久世 茂樹

 (32)優先日 平7 (1995) 1 月31日
 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株

 式会社内
 式会社内

(33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 田中 謙次

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株

式会社内

(72)発明者 菅 浩一

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株

式会社内

(74)代理人 弁理士 大谷 保

(54)【発明の名称】 ポリカーボネートの製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 反応速度を向上させることができ、かつ耐熱性及び耐加水分解性などに優れ、色調の良好な高品質のポリカーボネートを、エステル交換反応により、効率よく製造する方法を提供すること。

【解決手段】 重合触媒として、(a) 含窒素有機塩基性化合物と(b) 四級ホスホニウム塩との組合せを用い、エステル交換反応によりポリカーボネートを製造する方法である。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 エステル変換反応によりポリカーボネー トを製造するに当たり、重合触媒として、(a)含窒素 有機塩基性化合物と(b) 4級ホスホニウム塩との組合 せを用いることを特徴とするポリカーボネートの製造方 法。

【請求項2】 含窒素有機塩基性化合物が、4級アンモ ニウム塩である請求項1記載のポリカーボネートの製造 方法。

【請求項3】 含窒素有機塩基性化合物が、一般式 (I)

$$(NR_{14}) + (X_{1}) - \cdot \cdot \cdot (I)$$

〔式中、R¹ は有機基を示し、4つのR¹ はたがいに同 一でも異なっていてもよく、また二つのR<sup>1</sup> が結合して 環構造を形成していてもよい。X1 はハロゲン原子,水 酸基、アルキルオキシ基、アリールオキシ基、アルキル カルボニルオキシ基,アリールカルボニルオキシ基,H CO3 又はBR4 (Rは水素原子又は炭化水素基を示 し、4つのRはたがいに同一でも異なっていてもよい) を示す。〕若しくは、一般式(II)

$$(NR_4) +_2 (Y_1)^{2} \cdot \cdot \cdot (II)$$

$$((R^3 \longrightarrow n P (\bigcirc)_{4-n})^+ (X^3)^-$$

〔式中、R3 は有機基を示し、たがいに同一でも異なっ ていてもよく、X3 はハロゲン原子、水酸基、アルキル オキシ基、アリールオキシ基、アルキルカルボニルオキ シ基, アリールカルボニルオキシ基, HCO。又はBR※

$$((R^3 \longrightarrow_{\overline{n}} P + (\bigcirc)_{4-n})^+_2 (Y^3)^{2-} \cdot \cdot \cdot (VI)$$

【化2】

〔式中、R³は一般式(V)と同様であり、Y³はCO 30 ₃ を示す。〕で表される化合物である請求項1記載のポ リカーボネートの製造方法。

【請求項6】 エステル交換反応の原料が、(A)ジヒ ドロキシ化合物及び(B)炭酸ジエステルである請求項 1記載のポリカーボネートの製造方法。

(A) 成分のジヒドロキシ化合物が、 【請求項7】 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンであ る請求項6記載のポリカーボネートの製造方法。

(B)成分の炭酸ジエステルが、ジフェ ニルカーボネートである請求項6記載のポリカーボネー 40 ーボネートの製造方法。 トの製造方法。

【請求項9】 反応終了後、触媒の分解温度以上で反応 生成物を熱処理する請求項1記載のポリカーボネートの 製造方法。

【請求項10】 (a) 成分がテトラメチルアンモニウ ムヒドロキシドであり、(b) 成分がテトラフェニルホ スホニウムテトラフェニルボレート, テトラフェニルホ スホニウムフェノラート又はテトラフェニルホスホニウ ムヒドロキサイドである請求項4記載のポリカーボネー トの製造方法。

\* 〔式中、R¹ は一般式(I)と同様であり、Y¹ はCO 3 を示す。〕で表される4級アンモニウム塩、又は、ジ メチルアミノピリジンである請求項1記載のポリカーボ ネートの製造方法。

2

【請求項4】 4級ホスホニウム塩が、一般式(III)  $(PR^{2}_{4}) + (X^{2}) - \cdot \cdot \cdot (III)$ 

〔式中、R2 は有機基を示し、4つのR2 はたがいに同 一でも異なっていてもよく、また二つのR<sup>2</sup> が結合して 環構造を形成していてもよい。X2 はハロゲン原子, 水 10 酸基, アルキルオキシ基, アリールオキシ基, (R' O)<sub>2</sub> P (=O) O (R' は炭化水素基を示し、二つの R'Oはたがいに同一でも異なっていてもよい)又はB R'', (R''は水素原子又は炭化水素基を示し、4つの R''はたがいに同一でも異なっていてもよい)を示 す。〕又は、一般式 (IV)

 $(PR_{4})_{1}^{2} (Y_{1})_{2}^{2} \cdots (IV)$ 

〔式中、R<sup>2</sup> は一般式 (III)と同様であり、Y<sup>2</sup> はCO ₃ を示す。〕で表される化合物である請求項1記載のポ リカーボネートの製造方法。

20 【請求項5】 4級ホスホニウム塩が、一般式(V) 【化1】

※4 (Rは水素原子又は炭化水素基を示し、4つのRはた がいに同一でも異なっていてもよい)を示し、nは0~ 4の整数を示す。〕又は、一般式 (VI)

 $\cdot \cdot \cdot (V)$ 

【請求項11】 (a) 成分がテトラメチルアンモニウ ムヒドロキシドであり、(b)成分がビフェニルトリフ ェニルホスホニウムテトラフェニルボレート, フェノキ シフェニルトリフェニルホスホニウムテトラフェニルボ レート、メトキシフェニルトリフェニルホスホニウムテ トラフェニルボレート, ビフェニルトリフェニルホスホ ニウムフェノキシド, フェノキシフェニルトリフェニル ホスホニウムフェノキシド及びメトキシフェニルトリフ ェニルホスホニウムフェノキシドからなる群より選ばれ た少なくとも1種の化合物である請求項5記載のポリカ

【請求項12】 得られるポリカーボネートの耐スチー ム性試験において、分子量低下率が10%以下であるこ とを特徴とする請求項10記載のポリカーボネートの製 造方法。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はポリカーボネートの 製造方法に関し、さらに詳しくは、エステル交換反応、 例えばジヒドロキシ化合物と炭酸ジエステルとを用いて 50 エステル交換反応によりポリカーボネートを製造する際

に、重合触媒として、含窒素有機塩基性化合物と4級ホスホニウム塩との組合せを用いることにより、触媒活性が充分に高く、反応速度を向上させうるとともに、反応最終段階で該触媒の熱分解による除去が可能であって、品質に優れたポリカーボネートを効率よく製造しうる方法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】ポリカーボネートは、透明性、耐熱性あ るいは耐衝撃性に優れたエンジニアリングプラスチック であって、現在、電気・電子分野, 自動車分野, 光学部 10 品分野, その他工業分野で広く使用されている。一般 に、ポリカーボネートの製造方法としては、芳香族ジヒ ドロキシ化合物とホスゲンとを直接反応させる方法(界 面重縮合法)、あるいは芳香族ジヒドロキシ化合物と炭 酸ジエステルとを溶融状態でエステル交換反応させる方 法(溶融重合法)が知られている。このポリカーボネー トの製造方法において、界面重縮合法は、①有毒なホス ゲンを用いなければならないこと、②副生する塩化水素 や塩化ナトリウムなどの含塩素化合物によって製造装置 が腐蝕すること、③樹脂中に混入する塩化ナトリウムな 20 どポリマーの物性に悪影響を及ぼす不純物の分離が困難 なことなどの諸問題がある。一方、エステル交換反応法 (溶融重合法) は、界面重縮合法に比べて、ポリカーボ ネートを安価に製造しうるという利点を有するものの、 通常280~310℃という高温下で長時間に反応させ るために、得られるポリカーボネートが着色するのを免 れないという大きな欠点がある上、塩基性触媒を用いる ことが多く、その結果得られるポリカーボネートの耐加 水分解性が悪いという問題もあった。

【0003】そこで、このエステル交換反応法(溶融重 30 合法)において、ポリカーボネートの着色問題を解決す るために、例えば特定の触媒を使用する方法(特公昭6 1-39972号公報,特開昭63-223036号公 報など)、反応後期に酸化防止剤を添加する方法(特開 昭61-151236号公報,特開昭62-15871 9号公報など)、反応後期に二軸ベント式混練押出機 (特開昭61-62522号公報など)や模型攪拌重合 槽(特開平2-153925号公報など)を使用する方 法などが提案されている。しかしながら、これらの方法 においても、ポリカーボネートの着色問題については、 まだ充分には解決されていない。一方、ポリカーボネー トの耐加水分解性を改良する方法として、従来よりジメ チル硫酸のような酸により中和することが知られてお り、また最近ではp-トルエンスルホン酸のような酸で 中和を行い、過剰の酸をエポキシ化合物で中和する技術 が開示されているが(特開平4-175368号公報な ど)、これらの技術では、ポリカーボネートの耐加水分

4 解性を充分に改良することができないのが実状である。 【0004】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 従来のエステル交換反応によるポリカーボネートの製造 方法がもつ欠点を改良し、反応速度を向上させることが でき、かつ耐熱性や耐加水分解性などに優れ、色調の良 好な高品質のポリカーボネートを効率よく製造しうる方 法を提供することを目的とするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者は、前記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、ジヒドロキシ化合物と炭酸ジエステルなどを用いてエステル交換反応を行う際に、触媒として、含窒素有機塩基性化合物と4級ホスホニウム塩との組合せを用いることにより、エステル交換反応の初期から後期にわたって充分な触媒活性を有し、かつ反応の最終段階で熱分解が可能で、ポリマーの品質低下をもたらすことがなく、その目的を達成しうることを見出した。本発明はかかる知見に基づいて完成したものである。すなわち、本発明は、エステル交換反応によりポリカーボネートを製造するに当たり、重合触媒として、(a)含窒素有機塩基性化合物と(b)4級ホスホニウム塩との組合せを用いることを特徴とするポリカーボネートの製造方法を提供するものである。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明においては、エステル交換 反応によりポリカーボネートが製造される。このエステル交換法において用いられる原料については、特に制限 はなく、通常のエステル交換法による製造に供される各種のものが用いられる。例えば、エステル交換反応において、①(A)成分としてジヒドロキシ化合物及び(B)成分として炭酸ジエステル、②(A)成分としてジヒドロキシ化合物のジエステル及び(B)成分として炭酸ジエステル、③(A)成分としてジヒドロキシ化合物のジ炭酸エステル(自己なり、⑤ジヒドロキシ化合物のジ炭酸エステル(自己エステル交換)などが挙げられる。これらの中では、①の(A)成分としてジヒドロキシ化合物及び(B)成分として炭酸ジエステルとが好ましく用いられる。

40 【0007】ここで、エステル交換反応に好ましく用いられる(A)成分のジヒドロキシ化合物は、例えば、芳香族ジヒドロキシ化合物,脂肪族ジヒドロキシ化合物が挙げられ、これらから選択される少なくとも一種の化合物である。この(A)成分の一つとして用いられる芳香族ジヒドロキシ化合物は、一般式(VII)

[0008]

【化3】

【0009】で表される化合物を挙げることができる。 上記一般式 (VII)において、R4 及びR5 は、それぞれ フッ素, 塩素, 臭素, ヨウ素のハロゲン原子又は炭素数 1~8のアルキル基、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基, イソプロピル基, n-ブチル基, イソブチ ル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、ペンチル基、 ヘキシル基、シクロヘキシル基、ヘブチル基、オクチル 基などを示す。R⁴ 及びR⁵ はたがいに同一であっても 異なっていてもよい。またR⁴ が複数ある場合は複数の R⁴ は同一でも異なっていてもよく、R⁵ が複数ある場\*

【0011】で示される結合を示す。炭素数1~8のア ルキレン基、炭素数2~8のアルキリデン基としては、 例えばメチレン基, エチレン基, プロピレン基, ブチレ ン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、エチリデン基、イ ソプロピリデン基などが挙げられ、炭素数5~15のシ ン基としては、例えばシクロペンチレン基、シクロヘキ シレン基、シクロペンチリデン基、シクロヘキシリデン 基などが挙げられる。

【0012】上記一般式 (VII)で表される芳香族ジヒド ロキシ化合物としては、例えばビス(4-ヒドロキシフ ェニル) メタン; ビス (3-メチル-4-ヒドロキシフ ェニル)メタン;ビス(3-クロロ-4-ヒドロキシフ ェニル)メタン:ビス(3,5-ジブロモ-4-ヒドロ キシフェニル) メタン; 1, 1-ビス(4-ヒドロキシ ーヒドロキシー3-メチルフェニル)エタン;1,1-ビス (2-t-ブチル-4-ヒドロキシ-3-メチルフ ェニル) エタン; 1-フェニル-1, 1-ビス(3-フ ルオロー4-ヒドロキシー3-メチルフェニル) エタ ン:2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン (通称ビスフェノールA);2,2-ビス(3-メチル) -4-ヒドロキシフェニル)プロパン;2,2-ビス (2-メチル-4-ヒドロキシフェニル)プロパン; 2, 2-ビス(3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェ \*合は複数のR<sup>5</sup> は同一でも異なっていてもよい。m及び nは、それぞれ0~4の整数である。そして、Zは単結 合、炭素数1~8のアルキレン基、炭素数2~8のアル キリデン基、炭素数5~15のシクロアルキレン基、炭 素数5~15のシクロアルキリデン基、又は-S-、-S〇一、一S〇2一、一〇一、一〇〇一結合若しくは式 (VIII) , (VIII')

[0010] 【化4】

· (VIII)

· (VIII')

ヒドロキシー5-メチルフェニル)プロパン:2,2-ビス (3-クロロ-4-ヒドロキシフェニル) プロパ ン; 2, 2-ビス(3-フルオロ-4-ヒドロキシフェ ニル)プロパン;2,2-ビス(3-ブロモ-4-ヒド ロキシフェニル) プロパン: 2, 2-ビス(3, 5-ジ クロアルキレン基,炭素数 $5\sim15$ のシクロアルキリデ 30 フルオロー4-ヒドロキシフェニル)プロパン;2,2- ビス (3, 5 - ジクロロ - 4 - ヒドロキシフェニル) プロパン:2,2-ビス(3,5-ジブロモ-4-ヒド ロキシフェニル) プロパン; 2, 2-ビス(4-ヒドロ キシフェニル) ブタン;2,2-ビス(4-ヒドロキシ フェニル) オクタン; 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフ ェニル)フェニルメタン;2,2-ビス(4-ヒドロキ シ-1-メチルフェニル)プロパン;1,1-ビス(4 -ヒドロキシ-t-ブチルフェニル)プロパン;2,2 -ビス(4-ヒドロキシ-3-ブロモフェニル)プロパ フェニル) エタン; 1, 1ービス (2-t-7)チルー4 40 ン; 2, 2ービス (4-t) にいっち (4-t) の (4-t) にいっち (4-t) の フェニル) プロパン; 2, 2-ビス(4-ヒドロキシー 3-クロロフェニル)プロパン;2,2-ビス(4-ヒ ドロキシー3, 5-ジクロロフェニル) プロパン; 2, 2-ビス(4-ヒドロキシ-3,5-ジブロモフェニ ル)プロパン;2,2-ビス(3-ブロモ-4-ヒドロ キシー5-クロロフェニル)プロパン:2,2-ビス (3-フェニルー4-ヒドロキシフェニル)プロパン;  $2, 2 - \forall x (4 - \forall x) = (4 -$ 2-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)ブタ ニル) プロパン; 1, 1 – ビス(2 – t – ブチルー4 – 50 ン; 1, 1 – ビス(2 – ブチルー4 – ヒドロキシー5 –

メチルフェニル) ブタン;1,1-ビス(2-t-ブチ ルー4-ヒドロキシー5-メチルフェニル)ブタン; 1, 1-ビス(2-t-ブチル-4-ヒドロキシ-5-メチルフェニル) イソブタン;1,1-ビス(2-t-アミルー4ーヒドロキシー5ーメチルフェニル) ブタ ン:2,2-ビス(3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシ フェニル) ブタン; 2, 2-ビス(3, 5-ジブロモー 4-ヒドロキシフェニル) ブタン; 4, 4-ビス (4-ヒドロキシフェニル) ヘプタン; 1, 1-ビス(2-t ーブチルー4ーヒドロキシー5ーメチルフェニル) ヘプ 10 タン; 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)オクタ ビス(ヒドロキシアリール)アルカン類;1,1-ビス (4-ヒドロキシフェニル)シクロペンタン;1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン;1, 1-ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)シク ロヘキサン; 1, 1-ビス(3-シクロヘキシル-4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン;1,1-ビス (3-フェニル-4-ヒドロキシフェニル) シクロヘキ サン; 1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサンなどのビス(ヒドロ キシアリール)シクロアルカン類;ビス(4-ヒドロキ シフェニル) エーテル:ビス(4,-ヒドロキシ-3-メチルフェニル)エーテルなどのビス(ヒドロキシアリ ール) エーテル類:ビス(4-ヒドロキシフェニル)ス ルフィド;ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニ ル) スルフィドなどのビス (ヒドロキシアリール) スル フィド類;ビス(4-ヒドロキシフェニル)スルホキシ ド:ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)スル ホキシド;ビス(3-フェニル-4-ヒドロキシフェニ 30 ル)スルホキシドなどのビス(ヒドロキシアリール)ス ルホキシド類:ビス(4ヒドロキシフェニル)スルホ ン;ビス(3-メチル-4-ヒドロキシフェニル)スル ホン;ビス(3-フェニル-4-ヒドロキシフェニル) スルホンなどのビス (ヒドロキシアリール) スルホン 類、4、4'ージヒドロキシビフェニル;4、4'ージ ヒドロキシー2、2'ージメチルビフェニル;4,4' -ジヒドロキシ-3、3'-ジメチルビフェニル:4, 4'-ジヒドロキシ-3、3'-ジシクロヘキシルビフ ェニル; 3、3' -ジフルオロ-4, 4' -ジヒドロキ 40シビフェニルなどのジヒドロキシビフェニル類などが挙 げられる。

【0013】上記一般式 (VII)以外の芳香族ジヒドロキシ化合物としては、ジヒドロキシベンゼン類、ハロゲン及びアルキル置換ジヒドロキシベンゼン類などがある。\*

O || | A r ¹ O C O A r ²

【0017】(式中、Ar¹ 及びAr² はそれぞれアリール基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていて 50

\*例えば、レゾルシン、3-メチルレゾルシン、3-エチルレゾルシン、3-プロピルレゾルシン、3-ブチルレゾルシン、3-フェニルレゾルシン、3-クミルレゾルシン;2,3,4,6-テトラブロ

8

トラフルオロレゾルシン; 2, 3, 4, 6 - テトラブロ モレゾルシン; カテコール, ハイドロキノン, 3 - メチ ルハイドロキノン, 3 - エチルハイドロキノン, 3 - プ ロピルハイドロキノン, 3 - ブチルハイドロキノン, 3 - t - ブチルハイドロキノン, 3 - フェニルハイドロキ

ノン, 3-クミルハイドロキノン; 2, 5-ジクロロハイドロキノン; 2, 3, 5, 6-テトラメチルハイドロキノン; 2, 3, 4, 6-テトラ-t-プチルハイドロ

キノン; 2, 3, 5, 6 - テトラブルオロハイドロキノン; 2, 3, 5, 6 - テトラブロモハイドロキノンなどが挙げられる。

【0014】また、(A)成分の一つとして用いられる 脂肪族ジヒドロキシ化合物としては、各種のものがあ る。例えば、ブタン-1, 4-ジオール; 2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール;ヘキサン-1, 6-20 ジオール;ジエチレングリコール;トリエチレングリコ ール; テトラエチレングリコール; オクタエチレングリ コール;ジプロピレングリコール; N, N-メチルジエ タノールアミン:シクロヘキサン-1,3-ジオール: シクロヘキサン-1, 4-ジオール;1, 4-ジメチロ ールシクロヘキサン:p-キシリレングリコール:2. 2-ビス-(4-ヒドロキシシクロヘキシル)-プロパ ン及び二価アルコール又はフェノールのエトキシ化また はプロポキシ化生成物、例えばビスーオキシエチルービ スフェノールA:ビス-オキシエチル-テトラクロロビ スフェノールA又はビス-オキシエチル-テトラクロロ ヒドロキノンなどが挙げられる。

【0015】本発明の好ましい製造方法において、

(A) 成分のジヒドロキシ化合物としては、上記の化合物一種又は二種以上を適宜選択して用いるが、これらの中では、芳香族ジヒドロキシ化合物であるビスフェノールAを用いるのが好ましい。一方、本発明において、

(B) 成分として用いられる炭酸ジエステルは、各種のものがある。例えば、炭酸ジアリール化合物、炭酸ジアルキル化合物又は炭酸アルキルアリール化合物から選択される少なくとも一種の化合物である。この(B) 成分の一つとして用いられる炭酸ジアリール化合物は、一般式(IX)

【0016】 【化5】

 $\cdots$  (IX)

もよい。) で表される化合物、又は一般式 (X) 【0018】

【化6】

【0019】(式中、Ar<sup>®</sup> 及びAr<sup>®</sup> はそれぞれアリール基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよく、D<sup>®</sup> は前記芳香族ジヒドロキシ化合物から水酸基2個を除いた残基を示す。)で表される化合物であ\*

\*る。また、炭酸ジアルキル化合物は、一般式 (XI) 【0020】 【化7】

10

 $\cdots$  (XI)

【0021】(式中、R<sup>6</sup>及びR<sup>7</sup>はそれぞれ炭素数1~6のアルキル基又は炭素数4~7のシクロアルキル基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよ※

※い。)で表される化合物、又は一般式(XII)【0022】【化8】

【0023】 (式中、R<sup>®</sup> 及びR<sup>®</sup> はそれぞれ炭素数1 ~6のアルキル基又は炭素数4~7のシクロアルキル基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよ 20 く、D<sup>®</sup> は前記芳香族ジヒドロキシ化合物から水酸基2★

★個を除いた残基を示す。)で表される化合物である。そして、炭酸アルキルアリール化合物は、一般式(XIII)

[0024]

【化9】

· · · (XIII)

【0025】(式中、 $Ar^5$  はアリール基、 $R^{10}$  は炭素数  $1\sim6$  のアルキル基又は炭素数  $4\sim7$  のシクロアルキル基を示す。)で表される化合物、又は一般式(XIV)

☆【0026】 【化10】

【0027】(式中、Ar<sup>6</sup> はアリール基、R<sup>11</sup>は炭素数1~6のアルキル基又は炭素数4~7のシクロアルキル基、D<sup>8</sup> は前記芳香族ジヒドロキシ化合物から水酸基2個を除いた残基を示す。)で表される化合物である。ここで、炭酸ジアリール化合物としては、例えば、ジフェニルカーボネート、ジトリルカーボネート、ビス(クロロフェニル)カーボネート、mークレジルカーボネート、ジナフチルカーボネート、ビス(ジフェニル)カーボネート、ビスフェノールAビスフェニルカーボネートなどが挙げられる。また、炭酸ジアルキル化合物として40は、例えば、ジエチルカーボネート、ジメチルカーボネート、ジブチルカーボネート、ジンチルカーボネート、ジブチルカーボネート、ジシクロヘキシルカーボネート、ビスフェノールAビスメチルカーボネートなどが挙げられる。

【0028】そして、炭酸アルキルアリール化合物とし を挙げることができる。 ては、例えば、メチルフェニルカーボネート、エチルフ エニルカーボネート、ブチルフェニルカーボネート、シ Aモノメチル炭酸エステルカロヘキシルフェニルカーボネート、ビスフェノールA ル炭酸エステル、ビスフェメール ステル、ビスフェノール において、(B) 成分の炭酸ジエステルとしては、上記 50 どを挙げることができる。

の化合物一種又は二種以上を適宜選択して用いるが、これらの中では、ジフェニルカーボネートを用いるのが好ましい。

【0029】次に、本発明に用いられる前記ジヒドロキ シ化合物及び前記炭酸ジエステル以外の原料としては、 次のものが挙げられる。すなわち、ジヒドロキシ化合物 のジエステル類としては、例えば、ビスフェノールAの ジ酢酸エステル、ビスフェノールAのジプロピオン酸エ ステル、ビスフェノールAのジブチル酸エステル、ビス フェノールAのジ安息香酸エステルなどを挙げることが できる。また、ジヒドロキシ化合物のジ炭酸エステル類 としては、例えば、ビスフェノールAのビスメチル炭酸 エステル、ビスフェノールAのビスエチル炭酸エステ ル、ビスフェノールAのビスフェニル炭酸エステルなど を挙げることができる。そして、ジヒドロキシ化合物の モノ炭酸エステル類としては、例えば、ビスフェノール Aモノメチル炭酸エステル, ビスフェノールAモノエチ ル炭酸エステル、ビスフェノールAモノプロピル炭酸エ ステル、ビスフェノールAモノフェニル炭酸エステルな

【0030】そして、本発明の製造方法においては、必 要に応じて末端停止剤を用いることができる。この末端 停止剤としては、例えばo-n-ブチルフェノール;m -n-ブチルフェノール;p-n-ブチルフェノール; o-イソブチルフェノール:m-イソブチルフェノー ル:p-イソブチルフェノール:o-t-ブチルフェノ ール; m-t-ブチルフェノール; p-t-ブチルフェ ノール; o-n-ペンチルフェノール; m-n-ペンチ ルフェノール;p-n-ペンチルフェノール;o-n-ヘキシルフェノール; m-n-ヘキシルフェノール; p 10 クミルフェノール; 3, 5-ジクミルフェノール; 式 -n-ヘキシルフェノール; o-シクロヘキシルフェノ ール:m-シクロヘキシルフェノール;p-シクロヘキ\*

\*シルフェノール; o-フェニルフェノール; m-フェニ ルフェノール; p-フェニルフェノール; o-n-ノニ ルフェノール; m-n-/ニルフェノール; p-n-/ ニルフェノール; o - クミルフェノール; m - クミルフ ェノール; p-クミルフェノール; o-ナフチルフェノ ール;m-ナフチルフェノール;p-ナフチルフェノー ル; 2,  $6 - \vec{y} - t - \vec{y}$  チルフェノール; 2,  $5 - \vec{y} - \vec{y}$ t-ブチルフェノール; 2, 4-ジ-t-ブチルフェノ ール; 3, 5-ジ-t-ブチルフェノール; <math>2, 5-ジ

12

[0031]

【化11】

で表される化合物や、式 [0032] 【化12】

【0033】で表されるクロマン誘導体などの一価フェ ノールが挙げられる。このようなフェノール類のうち、 本発明では特に限定されないが、p-t-ブチルフェノ ール、p-クミルフェノール、p-フェニルフェノール などが好ましい。また、式

[0034]

【化13】

-801-

13

$$\begin{array}{c}
O \\
\parallel \\
C \\
n \\
H \\
2 \\
n \\
n \\
1 \\
- \\
C \\
- \\
O
\end{array}$$

 $C_n H_{2n+1} - O H$ 

(式中、nは7~30の整数である。)

$$\begin{array}{cccc}
(R^{11}O)_{k} \\
& & & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
&$$

(式中、R<sup>11</sup>は炭素数1~12のアルキル基を示し、 kは1~3の整数である。)

【0035】で表される化合物なども用いることができ る。さらに、本発明では、必要に応じて、フロログルシ ン;トリメリット酸;1,1,1-トリス(4-ヒドロ キシフェニル) エタン:  $1 - (\alpha - \lambda + \mu - \alpha - (4))$ -ヒドロキシフェニル)エチル]-4-[lpha', lpha'-ビス (4"-ヒドロキシフェニル) エチル〕 ベンゼン;  $\alpha$ ,  $\alpha$ ',  $\alpha$ " -トリス (4-ヒドロキシフェニル) -1, 3, 5-トリイソプロピルベンゼン:イサチンビス きる。

【0036】本発明の製造方法においては、エステル交 換反応の際に、重合触媒として、(a)含窒素有機塩基 性化合物と(b) 4級ホスホニウム塩との組合せを用い ることが必要である。上記(a)成分の含窒素有機塩基 性化合物としては、特に制限はなく、各種のものがあ る。例えば、トリメチルアミン,トリエチルアミン,ト リプロピルアミン、トリブチルアミン、トリペンチルア ミン, トリヘキシルアミン, ジメチルベンジルアミンな どの脂肪族第三級アミン化合物、トリフェニルアミンな 40 どの芳香族第三級アミン化合物、N, N-ジメチル-4 -アミノピリジン、4-ジエチルアミノピリジン、4-ピロリジノピリジン、4-アミノピリジン、2-アミノ ピリジン, 2-ヒドロキシピリジン, 4-ヒドロキシピ リジン、2-メトキシピリジン、4-メトキシピリジ ン, イミダゾール, 2-メチルイミダゾール, 4-メチ ルイミダゾール, 2-ジメチルアミノイミダゾール, 2 -メトキシイミダゾール, 2-メルカプトイミダゾー ル,アミノキノリン,ジアザビシクロオクタン(DAB CO) などの含窒素複素環化合物が挙げられる。

【0037】さらに、一般式(1)  $(NR_{4}^{1}) + (X_{1}) - \cdots (I)$ 若しくは、一般式(II)  $(NR_{4}) +_{2} (Y_{1}) = \cdots (II)$ 

で表される4級アンモニウム塩を挙げることができる。 上記一般式(I)又は(II)において、RIは有機基、 例えばメチル基, エチル基, プロピル基, ブチル基, ペ ンチル基、ヘキシル基、オクチル基、シクロヘキシル基 (o-クレゾール)などを分岐剤として用いることもで *30* などのアルキル基やシクロアルキル基、フェニル基,ト リル基、ナフチル基、ビフェニル基などのアリール基、 ベンジル基などのアリールアルキル基などを示す。4つ のR¹ はたがいに同一でも異なっていてもよく、また二 つのR<sup>1</sup>が結合して環構造を形成していてもよい。また 一般式(I)において、X1 はハロゲン原子,水酸基, アルキルオキシ基、アリールオキシ基、アルキルカルボ ニルオキシ基, アリールカルボニルオキシ基, HCO3 又は $BR_4$  を示し、一般式 (II) において、 $Y^1$  はCO₃ を示す。。ここで、Rは水素原子又はアルキル基やア リール基などの炭化水素基を示し、4つのRはたがいに 同一でも異なっていてもよい。

> 【0038】このような4級アンモニウム塩としては、 例えばテトラメチルアンモニウムヒドロキシド, テトラ エチルアンモニウムヒドロキシド,テトラブチルアンモ ニウムヒドロキシド、トリメチルベンジルアンモニウム ヒドロキシドなどのアルキル基、アリール基、アルアリ ール基などを有するアンモニウムヒドロキシド類、テト ラメチルアンモニウムボロハイドライド, テトラブチル アンモニウムボロハイドライド, テトラブチルアンモニ 50 ウムテトラフェニルボレート, テトラメチルアンモニウ

ムテトラフェニルボレートなどの塩基性塩が挙げられ る。また、一般式(II)のような2価アニオンであって もよく、例えば、ビス(テトラメチルアンモニウム)カ ーボネート等が挙げられる。これらの含窒素有機塩基性 化合物の中で、触媒活性が高く、かつ熱分解が容易でポ リマー中に残留しにくいなどの点から、上記一般式 (I)で表される4級アンモニウム塩、具体的にはテト ラメチルアンモニウムヒドロキシド, テトラブチルアン モニウムヒドロキシド, テトラメチルアンモニウムボロ ハイドライド、テトラブチルアンモニウムボロハイドラ イドが好ましく、特にテトラメチルアンモニウムヒドロ キシドが好適である。この(a)成分の含窒素有機塩基 性化合物は一種用いてもよく、二種以上を組み合わせて 用いてもよい。

【0039】一方、(b) 成分の4級ホスホニウム塩と しては、特に制限はなく、各種のものがあり、例えば一 般式(III)

 $(PR^{2}_{4}) + (X^{2}) - \cdots (III)$ 又は、一般式(IV)

 $(PR^{2}_{4})^{+}_{2} (Y^{2})^{2} \cdots (IV)$ 

で表される化合物が好ましく用いられる。上記一般式 (III)又は(IV)において、R2は有機基を示し、この 有機基としては、上記一般式(I)におけるR¹の説明 において例示したものと同じものを挙げることができ る。4つのR2 はたがいに同一でも異なっていてもよ く、また二つのR<sup>2</sup> が結合して環構造を形成していても よい。一般式 (III)において、X2 はハロゲン原子,水 酸基、アルキルオキシ基、アリールオキシ基、(R' O) 2 P (=O) O, アルキルカルボニルオキシ基, ア リールカルボニルオキシ基, HCO。又はBR''。を示 30 す。ここで、R'はアルキル基やアリール基などの炭化 水素基を示し、二つのR'Oはたがいに同一でも異なっ ていてもよい。またR''は水素原子又はアルキル基やア リール基などの炭化水素基を示し、4つのR''はたがい に同一でも異なっていてもよい。また、一般式(IV)に おいて、Y<sup>2</sup> はCO<sub>3</sub> を示す。

【0040】このような4級ホスホニウム塩としては、 例えばテトラフェニルホスホニウムヒドロキシド、テト ラナフチルホスホニウムヒドロキシド, テトラ (クロロ フェニル)ホスホニウムヒドロキシド,テトラ(ビフェ *40* ボレート,テトラトリルホスホニウムテトラフェニルボ ニル)ホスホニウムヒドロキシド,テトラトリルホスホ ニウムヒドロキシド, テトラメチルホスホニウムヒドロ キシド, テトラエチルホスホニウムヒドロキシド, テト ラブチルホスホニウムヒドロキシド,テトラヘキシルホ スホニウムヒドロキシドなどのテトラ(アリール又はア ルキル)ホスホニウムヒドロキシド類、メチルトリフェ ニルホスホニウムヒドロキシド, エチルトリフェニルホ スホニウムヒドロキシド, プロピルトリフェニルホスホ ニウムヒドロキシド、ブチルトリフェニルホスホニウム

ロキシド, テトラデシルトリフェニルホスホニウムヒド ロキシド、ベンジルトリフェニルホスホニウムヒドロキ シド, エトキシベンジルトリフェニルホスホニウムヒド ロキシド、メトキシメチルトリフェニルホスホニウムヒ ドロキシド、アセトキシメチルトリフェニルホスホニウ ムヒドロキシド、フェナシルトリフェニルホスホニウム ヒドロキシド、クロロメチルトリフェニルホスホニウム ヒドロキシド、ブロモメチルトリフェニルホスホニウム ヒドロキシド、ビフェニルトリフェニルホスホニウムヒ ドロキシド、ナフチルトリフェニルホスホニウムヒドロ キシド, クロロフェニルトリフェニルホスホニウムヒド ロキシド、フェノキシフェニルトリフェニルホスホニウ ムヒドロキシド、メトキシフェニルトリフェニルホスホ ニウムヒドロキシド, アセトキシフェニルトリフェニル ホスホニウムヒドロキシド, ナフチルフェニルトリフェ ニルホスホニウムヒドロキシドなどのモノ(アリール又 はアルキル)トリフェニルホスホニウムヒドロキシド 類、エチルトリメチルホスホニウムヒドロキシド、ヘキ シルトリメチルホスホニウムヒドロキシド、オクチルト 20 リメチルホスホニウムヒドロキシド,フェニルトリメチ ルホスホニウムヒドロキシド、ビフェニルトリメチルホ スホニウムヒドロキシド, メチルトリヘキシルホスホニ ウムヒドロキシド、エチルトリヘキシルホスホニウムヒ ドロキシド、オクチルトリヘキシルホスホニウムヒドロ キシド、ステアリルトリヘキシルホスホニウムヒドロキ シド、フェニルトリヘキシルホスホニウムヒドロキシ ド、ビフェニルトリフェキシルホスホニウムヒドロキシ ドなどのモノ(アリール又はアルキル)トリアルキルホ スホニウムヒドロキシド類、ジメチルジフェニルホスホ ニウムヒドロキシド、ジエチルジフェニルホスホニウム ヒドロキシド、ジメチルジエチルホスホニウムヒドロキ シド, ジメチルジヘキシルホスホニウムヒドロキシド, ジ(ビフェニル)ジフェニルホスホニウムヒドロキシド などのジ(アリール又はアルキル)ジ(アリール又はア ルキル)ホスホニウムヒドロキシド類、さらにはテトラ フェニルホスホニウムテトラフェニルボレート,テトラ ナフチルホスホニウムテトラフェニルボレート, テトラ (クロロフェニル) ホスホニウムテトラフェニルボレー ト, テトラ (ビフェニル) ホスホニウムテトラフェニル レート, テトラメチルホスホニウムテトラフェニルボレ

16

ート, テトラエチルホスホニウムテトラフェニルボレー ト, テトラブチルホスホニウムテトラフェニルボレー ト,テトラヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレー ト, テトラオクチルホスホニウムテトラフェニルボレー トなどのテトラ(アリール又はアルキル)ホスホニウム テトラフェニルボレート類、メチルトリフェニルホスホ ニウムテトラフェニルボレート, エチルトリフェニルホ スホニウムテトラフェニルボレート, プロピルトリフェ ヒドロキシド,オクチルトリフェニルホスホニウムヒド 50 ニルホスホニウムテトラフェニルボレート,ブチルトリ

フェニルホスホニウムテトラフェニルボレート, オクチ ルトリフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート、 テトラデシルトリフェニルホスホニウムテトラフェニル ボレート、ベンジルトリフェニルホスホニウムテトラフ ェニルボレート, エトキシベンジルトリフェニルホスホ ニウムテトラフェニルボレート、メトキシメチルトリフ ェニルホスホニウムテトラフェニルボレート, アセトキ シメチルトリフェニルホスホニウムテトラフェニルボレ ート, フェナシルトリフェニルホスホニウムテトラフェ ニルボレート, クロロメチルトリフェニルホスホニウム テトラフェニルボレート, ブロモメチルトリフェニルホ スホニウムテトラフェニルボレート, ビフェニルトリフ ェニルホスホニウムテトラフェニルボレート、ナフチル トリフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート, ク ロロフェニルトリフェニルホスホニウムテトラフェニル ボレート、フェノキシフェニルトリフェニルホスホニウ ムテトラフェニルボレート, アセトキシフェニルトリフ ェニルホスホニウムテトラフェニルボレート, ナフチル フェニルトリフェニルホスホニウムテトラフェニルボレ ートなどのモノ(アリール又はアルキル)トリフェニル 20 の、例えばビス(テトラフェニルホスホニウム)カーボ ホスホニウムテトラフェニルボレート類、エチルトリメ チルホスホニウムテトラフェニルボレート, ヘキシルト リメチルホスホニウムテトラフェニルボレート、オクチ ルトリメチルホスホニウムテトラフェニルボレート,フ ェニルトリメチルホスホニウムテトラフェニルボレー ト, ビフェニルトリメチルホスホニウムテトラフェニル ボレート、メチルトリヘキシルホスホニウムテトラフェ ニルボレート, エチルトリヘキシルホスホニウムテトラ フェニルボレート, オクチルトリヘキシルホスホニウム テトラフェニルボレート、ステアリルトリヘキシルホス 30 ホニウムテトラフェニルボレート, フェニルトリヘキシ ルホスホニウムテトラフェニルボレート、ビフェニルト リフェキシルホスホニウムテトラフェニルボレートなど

ルホスホニウムテトラフェニルボレート、ジメチルジエ チルホスホニウムテトラフェニルボレート,ジメチルジ エチルホスホニウムテトラフェニルボレート, ジメチル ジヘキシルホスホニウムテトラフェニルボレート、ジ (ビフェニル) ジフェニルホスホニウムテトラフェニル ボレートなどのジ (アリール又はアルキル) ジ (アリー ル又はアルキル)ホスホニウムテトラフェニルボレート 10 類が挙げられる。 【0041】さらに、対アニオンとして、上記のヒドロ

18

\*ウムテトラフェニルボレート類、ジメチルジフェニルホ

スホニウムテトラフェニルボレート、ジエチルジフェニ

キシドやテトラフェニルボレート類の代わりに、フェノ キシドなどのアリールオキシ基、メトキシド、エトキシ ドなどのアルキルオキシ基、アセテートなどのアルキル カルボニルオキシ基、ベンゾネートなどのアリールカル ボニルオキシ基、クロライド、ブロマイドなどのハロゲ ン原子を用いた上記4級ホスホニウム塩が挙げられる。 また、上記一般式 (III)で表される化合物以外に、一般 式(IV)で表されるような2価の対アニオンを有するも ネート, ビス (ビフェニルトリフェニルホスホニウム) カーボネートなどの4級ホスホニウム塩や、さらに、例 えば2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン のビスーテトラフェニルホスホニウム塩、エチレンビス (トリフェニルホスホニウム) ジブロミド、トリメチレ ンビス(トリフェニルホスホニウム)-ビス(テトラフ ェニルボレート) なども挙げることができる。

【0042】さらに好ましくは、本発明の製造方法で は、エステル交換反応の際に、重合触媒として、含窒素 有機塩基性触媒と下記一般式(V)又は(VI)で表され る4級ホスホニウム化合物を組み合わせて用いることが 望ましい。ここで、一般式(V)は、

【化14】

$$((R^3 \longrightarrow n P (\bigcirc)_{4-n})^+ (X^3)^- \cdots (V)$$

〔式中、R³ は有機基を示し、たがいに同一でも異なっ ていてもよく、X³はハロゲン原子、水酸基、アルキル オキシ基、アリールオキシ基、アルキルカルボニルオキ シ基,アリールカルボニルオキシ基,HCO。又はBR 40 4 (Rは水素原子又は炭化水素基を示し、4つのRはた※

のモノ (アリール又はアルキル) トリアルキルホスホニ\*

※がいに同一でも異なっていてもよい)を示し、nは0~ 4の整数を示す。〕で表され、一般式 (VI) は、

[0043]

【化15】

$$((R^3 - \bigcirc)_n P + \bigcirc)_{4-n})_{2}^+ (Y^3)_{2}^2 \cdot \cdot \cdot (VI)$$

〔式中、R³ は一般式(V)と同様であり、Y³ はCO 3 を示す。〕で表される。

【0044】このような4級ホスホニウム化合物の具体 例としては、例えばテトラフェニルホスホニウムヒドロ キシド, ビフェニルトリフェニルホスホニウムヒドロキ シド、メトキシフェニルトリフェニルホスホニウムヒド ロキシド,フェノキシフェニルトリフェニルホスホニウ 50 レート,ナフチルフェニルトリフェニルホスホニウムテ

ムヒドロキシド、ナフチルフェニルトリフェニルホスホ ニウムヒドロキシド, テトラフェニルホスホニウムテト ラフェニルボレート, ビフェニルトリフェニルホスホニ ウムテトラフェニルボレート, メトキシフェニルトリフ ェニルホスホニウムテトラフェニルボレート, フェノキ シフェニルトリフェニルホスホニウムテトラフェニルボ

5倍モルになるような比率でエステル交換反応する。な お、状況に応じて、0.98~1.20倍モルが好ましい。 【0048】上記のエステル交換反応に当たって、前記 の一価フェノールなどからなる末端停止剤の存在量が、

(A) 成分であるジヒドロキシ化合物に対して、0.05 ~10モル%の範囲にあると、得られるポリカーボネー トの水酸基末端が封止されるため、耐熱性及び耐水性に 充分優れたポリカーボネートが得られる。このような前 記の一価フェノールなどからなる末端停止剤は、予め反 応系に全量添加しておいてもよい。また、予め反応系に 一部添加しておき、反応の進行に伴って残部を添加して もよい。さらに、場合によっては、前記(A)成分のジ ヒドロキシ化合物と(B)成分の炭酸ジエステルとのエ ステル交換反応が一部進行した後に、反応系に全量添加 してもよい。

20

【0049】本発明の製造方法に従ってエステル交換反 応を行うに当たっては、反応温度は、特に制限はなく、 通常100~330℃の範囲、好ましくは180~30 0℃の範囲で選ばれるが、より好ましくは、反応の進行 に合わせて次第に180~300℃まで温度を上げてい く方法がよい。このエステル交換反応の温度が100℃ 未満では反応速度が遅くなり、一方330℃を超えると 副反応が生じたり、あるいは生成するポリカーボネート が着色するなどの問題が生じ、好ましくない。また、反 応圧力は、使用するモノマーの蒸気圧や反応温度に応じ て設定される。これは、反応が効率良く行われるように 設定されればよく、限定されるものではない。通常、反 応初期においては、1~50atm (760~38,000 torr)までの大気圧(常圧)ないし加圧状態にしてお き、反応後期においては、減圧状態、好ましくは最終的 には0.01~100torrにする場合が多い。さらに、反 応時間は、目標の分子量となるまで行えばよく、通常、 0.2~10時間程度である。

【0050】そして、上記のエステル交換反応は、通常 不活性溶剤の不存在下で行われるが、必要に応じて、得 られるポリカーボネートの1~150重量%の不活性溶 剤の存在下において行ってもよい。ここで、不活性溶剤 としては、例えば、ジフェニルエーテル、ハロゲン化ジ フェニルエーテル, ベンゾフェノン, ポリフェニルエー 【0047】本発明の製造方法では、通常のエステル交 40 テル,ジクロロベンゼン,メチルナフタレンなどの芳香 族化合物、トリシクロ(5,2,10)デカン、シクロ オクタン、シクロデカンなどのシクロアルカンなどが挙 げられる。また、必要に応じて不活性ガス雰囲気下で行 ってもよく、ここで、不活性ガスとしては、例えばアル ゴン, 二酸化炭素, 一酸化二窒素, 窒素などのガス、ク ロロフルオロ炭化水素、エタンやプロパンなどのアルカ ン、エチレンやプロピレンなどのアルケンなど、各種の ものが挙げられる。

【0051】また、本発明においては、必要に応じ、酸

トラフェニルボレート, テトラフェニルホスホニウムフ ェノキシド、ビフェニルトリフェニルホスホニウムフェ ノキシド, メトキシフェニルトリフェニルホスホニウム フェノキシド、フェノキシフェニルトリフェニルホスホ ニウムフェノキシド, ナフチルフェニルトリフェニルホ スホニウムフェノキシド、テトラフェニルホスホニウム クロライド, ビフェニルトリフェニルホスホニウムクロ ライド、メトキシフェニルトリフェニルホスホニウムク ロライド, フェノキシフェニルトリフェニルホスホニウ ムクロライド又はナフチルフェニルトリフェニルホスホ 10 ニウムクロライドなどが挙げられる。

【0045】この(b)成分の4級ホスホニウム塩は一 種用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよ い。なお、これらの含窒素有機塩基性化合物及び4級ホ スホニウム塩は、金属不純物の含有量ができるだけ少な いものが好ましく、特にアルカリ金属及びアルカリ土類 金属化合物の含有量が50ppm以下のものが好適であ る。本発明においては、重合触媒として、上記(a)成 分の含窒素有機塩基性化合物を10-1~10-6モル、好 ましくは $10^{-2}$ ~ $10^{-5}$ モル、さらに好ましくは $10^{-3}$ ~10<sup>-4</sup> モル用い、(b) 成分の4級ホスホニウム塩を  $10^{-3} \sim 10^{-8}$  モル、好ましくは $10^{-4} \sim 10^{-7}$  モル、 さらに好ましくは10-5~10-6モル用いるのが望まし い。(a)成分の使用量が10<sup>-6</sup>モル未満では反応初期 での触媒活性が不充分となり、また10-1モルを超える とコストアップに繋がり好ましくない。一方、(b)成 分の使用量が10-8モル未満では反応後期での触媒活性 が不充分となり、また10-3モルを超えるとコストアッ プに繋がり好ましくない。

【0046】また、この重合触媒は、原料である(A) 成分のジヒドロキシ化合物1モルに対して、(a)成分 と(b) 成分との合計量が、通常10<sup>-1</sup>~10<sup>-8</sup>モル、 好ましくは $10^{-2}$ ~ $10^{-7}$ モル、さらに好ましくは10-3~10-6モルになるような割合で添加される。この触 媒の添加量が10-8モル未満では、触媒効果が発現され ないおそれがある。また、10-1モルを超えると、最終 製品であるポリカーボネートの物性、特に、耐熱性,耐 加水分解性の低下を招くおそれがあり、また、コストア ップに繋がり、これを超えてまで添加することはない。

換法によるポリカーボネートの製造に供される原料が用 いられるが、好ましくは、(A)成分のジヒドロキシ化 合物及び(B)成分の炭酸ジエステルと、必要に応じ末 端停止剤あるいは分岐剤等を用いてエステル交換反応を 行い、品質の優れたポリカーボネートを得ることができ る。具体的には、公知のエステル交換法に準じて反応を 進行させればよい。以下に、本発明の好ましい製造方法 の手順及び条件を具体的に示す。まず、(A)成分のジ ヒドロキシ化合物と(B)成分の炭酸ジエステルとを、 ジヒドロキシ化合物に対して炭酸ジエステルが0.9~1. 50 化防止剤を反応系に添加してもよい。この酸化防止剤と

30

しては、リン系酸化防止剤が好ましく、例えばトリメチ ルホスファイト、トリエチルホスファイト、トリブチル ホスファイト、トリオクチルホスファイト、トリノニル ホスファイト、トリデシルホスファイト、トリオクタデ シルホスファイト, ジステアリルペンタエリスチルジホ スファイト、トリス(2-クロロエチル) ホスファイ ト,トリス(2,3-ジクロロプロピル)ホスファイト などのトリアルキルホスファイト、トリシクロヘキシル ホスファイトなどのトリシクロアルキルホスファイト、 トリフェニルホスファイト, トリクレジルホスファイ ト, トリス (エチルフェニル) ホスファイト, トリス (ブチルフェニル) ホスファイト, トリス (ノニルフェ ニル)ホスファイト、トリス(ヒドロキシフェニル)ホ スファイトなどのトリアリールホスファイト、2-エチ ルヘキシルジフェニルホスファイトなどのモノアルキル ジアリールホスファイト、トリメチルホスフェート,ト リエチルホスフェート, トリブチルホスフェート, トリ オクチルホスフェート, トリデシルホスフェート, トリ オクタデシルホスフェート, ジステアリルペンタエリス リチルジホスフェート,トリス(2-クロロエチル)ホ 20 スフェート, トリス(2,3-ジクロロプロピル) ホス フェートなどのトリアルキルホスフェート、トリシクロ ヘキシルホスフェートなどのトリシクロアルキルホスフ ェート、トリフェニルホスフェート, トリクレジルホス フェート、トリス (ノニルフェニル) ホスフェート、2 -エチルフェニルジフェニルホスフェートなどのトリア リールホスフェートなどが挙げられる。

【0052】本発明においては、反応が進行するととも に、使用した炭酸ジエステルに対応するフェノール類, が反応器より脱離してゆく。これら脱離物は、分離、精 製しリサイクル使用も可能であり、これらを除去する設 備があれば好ましい。そして、本発明は、バッチ式又は 連続式に行うことができ、かつ任意の装置を使用するこ とができる。なお、連続式で製造する場合には、少なく とも二基以上の反応器を使用し、上記の反応条件を設定 するのが好ましい。本発明で用いられる反応器は、その 材質や構造は、特に制限はされないが、通常の攪拌機能 を有していればよい。ただし、反応後段においては粘度 が上昇するので高粘度型の攪拌機能を有するものが好ま 40 しい。さらに、反応器の形状は槽型のみならず、押出機 型のリアクターなどでもよい。

【0053】本発明においては、エステル交換反応終了 後、得られるポリカーボネートの品質(着色)を良好な ものとするために、触媒の分解温度以上、好ましくは3 00℃前後に反応物を熱処理して、触媒を熱分解除去す るのが好ましい。以上のようにして得られたポリカーボ

ネートは、そのまま造粒してもよく、また、押出機など を用いて成形することもできる。また、本発明によって 得られるポリカーボネートは、可塑剤、顔料、潤滑剤、 離型剤、安定剤、無機充填剤などのような周知の添加剤 を配合して使用することができる。さらに、このポリカ ーボネートは、ポリオレフィン、ポリスチレン、ポリエ ステル, ポリスルホネート, ポリアミド, ポリフェニレ ンエーテルなどの重合体とブレンドすることが可能であ る。特に、OH基、COOH基、NH2 基などを末端に 10 有するポリフェニレンエーテル,ポリエーテルニトリ ル、末端変性ポリシロキサン化合物、変性ポリプロピレ ン、変性ポリスチレンなどと併用すると効果的である。 上記のようにして得られたポリカーボネートは、その耐 スチーム性試験(例えば、121℃のスチームに48時 間暴露し、粘度平均分子量の低下を求める方法)におい て、分子量低下率 (ΔM/M<sub>0</sub>×100%: M<sub>0</sub>は初期分 子量, ΔMは分子量低下)が10%以下であるような、

22

[0054]

【実施例】次に、本発明を実施例及び比較例によりさら に詳しく説明するが、本発明はこれらの例によってなん ら限定されるものではない。

耐加水分解性などに優れたポリカーボネートである。

実施例1~6及び比較例1~3

内容積100ミリリットルの攪拌機付ニッケル鋼製オー トクレーブに、ビスフェノールA(BPA) 22.8g (0.1 モル), ジフェニルカーボネート 23.5 g (0.1 1モル)及び第1表に示す種類と量の触媒を仕込み、ア ルゴン置換を5回行った。混合物を180℃に加熱し、 アルゴン雰囲気下で30分間反応させた。次いで210 アルコール類、又はそれらのエステル類及び不活性溶剤 30  $\mathbb{C}$ に昇温して、次第に真空度を100  $\mathbb{C}$  1000分間反応させ、さらに240℃に昇温し、徐々に真空 度を10mmHgまで上げて30分間反応させた。次いで2 70℃に昇温し、真空度を2mmHgに上げ30分間反応さ せたのち、真空度0.3mmHgで30分間反応させ、反応を 終了させた。

> 【0055】次に、オートクレーブ内の粘稠で透明な縮 合物の粘度平均分子量を求めるとともに、該縮合物をプ レス成形し、厚さ1mm、直径10mmのプレートを作成 し、これを121℃のスチームに48時間暴露し、外観 及び粘度平均分子量の低下を求め、耐スチーム性を評価 した。結果を第1表に示す。なお、粘度平均分子量M v は、20℃の塩化メチレン中での極限粘度〔η〕を求 め、式

 $[\eta] = 1.23 \times 10^{-5} \times Mv^{0.88}$ より算出した。

[0056]

【表1】

第1表-1

	重合触媒			
	含窒素有機塩基性化合物		4級ホスホニウム塩	
	種類	使用量 (モル/モルBPA)	種類	使用量 (モル/モルBPA)
実施例1	ТМАН	2.5×10 <sup>-4</sup>	TPTB	1 ×10 <sup>-6</sup>
実施例2	ТМАН	2.5×10 <sup>-4</sup>	TPTB	1 ×10 <sup>-6</sup>
実施例3	ТМАН	2.5×10 <sup>-4</sup>	ТВРН	1 ×10 <sup>-5</sup>
実施例4	TMAH	2.5×10 <sup>-4</sup>	мтртв	1 ×10 <sup>-5</sup>
実施例 5	ТВАН	2.5×10 <sup>-4</sup>	TPTB	1 ×10 <sup>-5</sup>
実施例 6	TBAB	$2.5 \times 10^{-4}$	TPTB	1 ×10 <sup>-5</sup>
比較例1	ТМАН	2.5×10 <sup>-4</sup>		
比較例 2	ТМАН	2.5×10 <sup>-4</sup>	NaOH	1 ×10 <sup>-6</sup>
比較例3		_	ТРТВ	1 ×10 <sup>-5</sup>

【0057】〔注〕

TMAH: テトラメチルアンモニウムヒドロキシド (Na<1ppb, Ca<1ppb, K<1ppb)

TBAH: テトラブチルアンモニウムヒドロキシド(N

a < 5 ppm, K < 1 0 ppm

TBAB:テトラブチルアンモニウムボロハイドライド

(Na < 50 ppm)

TPTB:テトラフェニルホスホニウムテトラフェニル\*

\*ボレート (Na<1ppm, Mg<1ppm)

MTPTB: メチルトリフェニルホスホニウムテトラフ 20 エニルボレート (<math>Na < 7ppm, Mg < 5ppm) TBPH: テトラブチルホスホニウムヒドロキサイド (<math>Na < 40ppm, K < 5ppm)

【0058】 【表2】

第1表-2

	ポリカーボネート			
	粘度平均分子量	耐スチーム性		
	(M v)	外観	分子量低下 (ΔM v)	
実施例1	19,100	透明	1, 2 0 0	
実施例2	16.100	透明	1.000	
実施例3	18.100	透明	1.800	
実施例 4	17,000	透明	600	
実施例5	18,900	透明	1.800	
実施例6	19,900	透明	1,800	
比較例1	4,800		_	
比較例2	18.000	透明	2, 8 0 0	
比較例3	6, 6 0 0	_	<del></del>	

【0059】実施例 $7\sim12$ 及び比較例 $4\sim6$ 実施例1において、真空度0.3 mmHgの段階で、270 ℃ に代えて、290 ℃とした以外は、実施例1と同様にし て行った。触媒の種類と量、並びに試験結果を第2表に 示す。

【0060】実施例13~14

実施例1において、270℃, 真空度0.3mmHgで30分

間反応させた後、さらに、290℃,真空度0.3 mHgで 10 分間熱処理を行った以外は、実施例1 と同様にして 行った。触媒の種類と量、並びに試験結果を第2 表に示す。

[0061]

【表3】

第2表-1

	重合触媒			
	含窒素有機塩基性化合物		4級ホスホニウム塩	
	種類	使用量 (モル/モルBPA)	種類	使用量 (モル/モルBPA)
実施例7	TMAH	2.5×10 <sup>-4</sup>	вртв	1 ×10 <sup>-5</sup>
実施例8	ТМАН	2.5×10 <sup>-4</sup>	POPTB	1 ×10 <sup>-6</sup>
実施例 9	TMAH	2.5×10 <sup>-4</sup>	мортв	1 ×10 <sup>-5</sup>
実施例10	TMAH	2.5×10 <sup>-4</sup>	врро	1 ×10 <sup>-5</sup>
実施例11	ТМАН	2.5×10 <sup>-4</sup>	POPPO	1 ×10 <sup>-5</sup>
実施例12	ТМАН	2.5×10 <sup>-4</sup>	МОРРО	1 ×10 <sup>-5</sup>
比較例 4	TMAH	2.5×10 <sup>-4</sup>	_	-
比較例 5	ТМАН	2.5×10 <sup>-4</sup>	NaOH	1 ×10 <sup>-6</sup>
比較例6	TMAH	-	TPTB	1 ×10 <sup>-5</sup>
実施例13	TMAH	2.5×10 <sup>-4</sup>	ТРТВ	1 ×10 <sup>-5</sup>
実施例14	ТМАН	2.5×10 <sup>-4</sup>	ВРТВ	1 ×10 <sup>-6</sup>

## 【0062】〔注〕

TMAH: テトラメチルアンモニウムヒドロキシド (N a < 1 ppb, C a < 1 ppb, K < 1 ppb)

BPTB: ビフェニルトリフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート (Na<1 ppm, Ca<1 ppm, K<1 ppm)

POPTB:フェノキシフェニルトリフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート (Na < 1ppm, Ca < 1ppm, K < 1ppm)

MOPTB:メトキシフェニルトリフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート (Na < 1 ppm, Mg < 1 ppm)

BPPO: ビフェニルトリフェニルホスホニウムフェノ

キシド (Na<1ppm, Ca<1ppm, K<1ppm)

POPPO: フェノキシフェニルトリフェニルホスホニ ウムフェノキシド (Na<1ppm, Ca<1ppm, K<1ppm)

MOPPO:メトキシフェニルトリフェニルホスホニウムフェノキシド (Na<1ppm, Ca<1ppm, K<<1ppm)

30 TPTB:テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート(Na<1ppm, Mg<1ppm)</li>【0063】【表4】

第2表-2

	ポリカーボネート				
	粘度平均分子量		耐スチーム性		
	(M v)	外観	分子量低下 (ΔM v)		
実施例7	21.500	透明	300		
実施例8	21,000	透明	400		
実施例9	19,000	透明	500		
実施例10	20,500	透明	4 0 0		
実施例11	20,500	透明	500		
実施例12	19,500	透明	600		
比較例4	4.800	_			
比較例5	20,000	透明	2.900		
比較例 6	6,700	透明	_		
実施例13	21.500	透明	300		
実施例14	20,500	透明	300		

## [0064]

【発明の効果】本発明によると、エステル交換反応によるポリカーボネートの製造において、重合触媒として、含窒素有機塩基性化合物と4級ホスホニウム塩との組合せを用いることにより、触媒活性が充分に高く、反応速

度を向上させうるとともに、反応最終段階で該触媒の熱分解による除去が可能であって、耐熱性や耐加水分解性などに優れ、色調の良好な高品質のポリカーボネートを効率よく製造することができる。